

Title (en)
CLEANING METHOD AND DEVICE FOR ONE OR MULTIPLE PARTS OF AN APPLICATION SYSTEM

Title (de)
REINIGUNGSVERFAHREN UND REINIGUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN ODER MEHRERE TEILE EINES APPLIKATIONSSYSTEMS

Title (fr)
PROCEDE DE NETTOYAGE ET DISPOSITIF DE NETTOYAGE POUR UN OU PLUSIEURS ELEMENT D'UN SYSTEME D'APPLICATION

Publication
EP 3017875 A1 20160511 (DE)

Application
EP 15003104 A 20151030

Priority
DE 102014016364 A 20141105

Abstract (en)
[origin: US2016121372A1] A cleaning process for one or more parts of an application system by positioning one or more parts of the application system in a cleaning chamber, spraying the one or more parts of the application system with a medium using a plurality of spray devices, with the medium being supplied to the spray devices from an assembly group. One or more parts of the application system may be removed from the cleaning chamber, wherein during spraying the supply of media to the spray devices takes place in a sequence having a plurality of successive phases. At least two phases of the sequence differ in terms of the supply of the at least one medium to the spray devices. A cleaning device designed to carry out the cleaning process is also provided having a control device for controlling the supply of the medium to the spray devices.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Reinigungsverfahren für ein oder mehrere Teile (34) eines Applikationssystems (24) mit zumindest folgenden Verfahrensschritten: Positionieren der ein oder mehreren Teile (34) des Applikationssystems in einer Reinigungskammer (40), Bestrahlen der ein oder mehreren Teile (34) des Applikationssystems (24) mit einem Medium, wobei das Bestrahlen mittels mehrerer Sprühhvorrichtungen erfolgt, und wobei das Medium den Sprühhvorrichtungen von einer Baugruppe (64) zugeführt wird, Entfernen der ein oder mehreren Teile (34) des Applikationssystems (24) aus der Reinigungskammer (40), wobei im Rahmen des Verfahrensschritts des Bestrahleins die Medienzufuhr zu den Sprühhvorrichtungen in einer Sequenz mit mehreren aufeinanderfolgenden Phasen erfolgt, wobei zumindest zwei Phasen der Sequenz sich hinsichtlich der Zufuhr des mindestens einen Mediums zu den Sprühhvorrichtungen unterscheiden. Die Erfindung betrifft auch eine zur Durchführung des Reinigungsverfahrens ausgestaltete Reinigungsvorrichtung (38), wobei zur Steuerung der Zufuhr des Mediums zu den Sprühhvorrichtungen eine Steuereinrichtung (76) vorgesehen ist. Die Erfindung ermöglicht eine hocheffiziente Mediennutzung. Weiterhin können durch die Erfindung sowohl die Lösewirkung als auch der Abtransport gelöster Verschmutzungen verbessert werden.

IPC 8 full level
B05B 12/04 (2006.01); **B05B 15/02** (2006.01); **B05B 15/555** (2018.01); **B05B 13/04** (2006.01)

CPC (source: CN EP US)
B05B 12/04 (2013.01 - EP US); **B05B 12/14** (2013.01 - CN); **B05B 13/0421** (2013.01 - CN); **B05B 15/555** (2018.01 - EP US); **B08B 3/02** (2013.01 - CN US); **B08B 5/02** (2013.01 - CN); **B05B 13/0452** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [X] GB 2198033 A 19880608 - HONDA MOTOR CO LTD
• [X] US 5213117 A 19930525 - YAMAMOTO SOICHIRO [CA]
• [X] US 6210481 B1 20010403 - SAKAI HIROYUKI [JP], et al
• [X] EP 0991481 A1 20000412 - DRESTER AB [SE]
• [X] DE 10304836 A1 20040819 - BOSCH GMBH ROBERT [DE]
• [X] DE 10110098 A1 20020905 - BARAL KARL-HEINZ [DE]
• [X] US 2008011333 A1 20080117 - RODGERS MICHAEL C [US], et al & US 2006048803 A1 20060309 - JESSUP PHILIP [CA], et al
• [X] WO 9506523 A1 19950309 - KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP], et al
• [XP] EP 2865454 A1 20150429 - HAPPY DYNAMICS INC [CA]

Cited by
WO2020193080A1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3017875 A1 20160511; **EP 3017875 B1 20180905**; CN 105562383 A 20160511; DE 102014016364 A1 20160512; PL 3017875 T3 20190228; US 2016121372 A1 20160505

DOCDB simple family (application)
EP 15003104 A 20151030; CN 201510640662 A 20150930; DE 102014016364 A 20141105; PL 15003104 T 20151030; US 201514933202 A 20151105